

大きく依存している。

中央公害対策審議会は、環境大気中炭化水素濃度と光化学オキシダントの生成との定量的関係を求めて総合的な検討を行い、光化学オキシダント生成防止のための必要条件としての環境大気中の非メタン炭化水素レベルの指針として、次の数値を示している。

「光化学オキシダントの日最高1時間値 0.06 ppm に対応する午前6時から9時までの非メタン炭化水素の3時間平均値は0.20 ppmC から 0.31 ppmC の範囲にある」

13 指定物質、指定物質排出施設及び指定物質抑制基準

有害大気汚染物質のうち早急にその排出を抑制すべき物質である指定物質（平成23年3月31日現在政令で次の3物質が指定されている。：ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン）を排出する指定物質排出施設（政令で指定：一定規模以上の乾燥施設、蒸留施設等）について、指定物質及び指定物質排出施設の種類ごとに指定物質の排出の抑制に関する基準（指定物質抑制基準）が定められている。

指定物質排出施設の設置者は、設置にあたって知事へ設置届出等の義務はないが、指定物質排出施設の設置者は、排出口において指定物質ごとの指定物質抑制基準値を遵守しなければならない。

指定物質、指定物質排出施設及び指定物質抑制基準は、別紙1のとおりである。

ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン（別紙1）
既設の施設（平成9年4月1日現在において、既に設置されている施設、又は設置の工事を行っている施設）については、平成10年4月1日から適用される。
新設の施設（平成9年4月2日以降、新たに設置する施設）については、設置の日から適用される。

別紙 1

指定物質排出施設及び指定物質抑制基準

(1) ベンゼンに係る指定物質排出施設と指定物質抑制基準

指定物質排出施設（政令で指定）	指定物質抑制基準（告示で設定）
1 ベンゼン（濃度が体積百分率60%以上のものに限る。以下同じ。）を蒸発させるための乾燥施設であって、送風機の送風能力が1,000 m ³ /時以上のもの	溶媒として使用したベンゼンを蒸発させるためのものに限定。 既設：200 mg/m ³ （排ガス量1,000 m ³ /h以上3,000 m ³ /h未満） 100 mg/m ³ （排ガス量3,000 m ³ /h以上） 新設：100 mg/m ³ （排ガス量1,000 m ³ /h以上3,000 m ³ /h未満） 50 mg/m ³ （排ガス量3,000 m ³ /h以上）
2 原料の処理能力が20 t/日以上のコークス炉	装炭時の装炭口からの排出ガスで装炭車集じん機の排出口から排出されるものに対して適用。 既設：100 mg/m ³ （特殊構造炉の適用除外あり） 新設：100 mg/m ³
3 ベンゼンの回収の用に供する蒸留施設（常圧蒸留施設を除く。）	溶媒として使用したベンゼンの回収の用に供するものに限定。 既設：200 mg/m ³ （排ガス量1,000 m ³ /h以上） 新設：100 mg/m ³ （排ガス量1,000 m ³ /h以上）
4 ベンゼンの製造の用に供する脱アルキル反応施設（密閉式のものを除く。）	フレアスタックで処理するものを除外。 既設：100 mg/m ³ 新設：50 mg/m ³
5 ベンゼンの貯蔵タンクであって、容量が500kL以上のもの	浮屋根式のもの除外。また、基準はベンゼンの注入時の排出ガスに対して適用。 既設：1,500 mg/m ³ （容量1,000kL以上） 新設：600 mg/m ³
6 ベンゼンを原料として使用する反応施設であって、ベンゼンの処理能力が1 t/時以上のもの（密閉式のものを除く。）	フレアスタックで処理するものを除外。 既設：200 mg/m ³ （排ガス量1,000 m ³ /h以上3,000 m ³ /h未満） 100 mg/m ³ （排ガス量3,000 m ³ /h以上） 新設：100 mg/m ³ （排ガス量1,000 m ³ /h以上3,000 m ³ /h未満） 50 mg/m ³ （排ガス量3,000 m ³ /h以上）

(2) トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンに係る指定物質排出施設と指定物質抑制基準

指定物質排出施設（政令で指定）	指定物質抑制基準（告示で設定）
7 トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレン（以下「トリクロロエチレン等」という。）を蒸発させるための乾燥施設であって、送風機の送風能力が 1,000 m ³ /時 以上のもの	溶媒として使用したトリクロロエチレン等を蒸発させるためのものに限定。 既設：500 mg/m ³ 新設：300 mg/m ³
8 トリクロロエチレン等の混合施設であって混合槽の容量が 5 kL 以上のもの（密閉式のものを除く。）	溶媒としてトリクロロエチレン等を使用するものに限定。 既設：500 mg/m ³ 新設：300 mg/m ³
9 トリクロロエチレン等の精製又は回収の用に供する蒸留施設（密閉式のものを除く。）	トリクロロエチレン等の精製の用に供するもの及び原料として使用したトリクロロエチレン等の回収の用に供するものに限定。 既設：300 mg/m ³ 新設：150 mg/m ³
10 トリクロロエチレン等による洗浄施設（次号に掲げるものを除く。）であって、トリクロロエチレン等が空気に接する面の面積が 3 m ² 以上のもの	既設：500 mg/m ³ 新設：300 mg/m ³
11 テトラクロロエチレンによるドライクリーニング機であって、処理能力が 30 kg/回 以上のもの	密閉式のもの除外。 既設：500 mg/m ³ 新設：300 mg/m ³